

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Verfahren zur Aufbringung eines Schutzschichtmaterials (9,9') auf eine Strukturschicht (7) zur Ausbildung einer Schutzschicht (10, 10'), vorzugsweise einer Oxidschicht, bevorzugter einer Siliziumdioxidschicht, auf der Strukturschicht (7), dadurch gekennzeichnet, dass die Aufbringung des Schutzschichtmaterials (9,9') bei einer Temperatur kleiner als 200°C, vorzugsweise kleiner als 100°C, noch bevorzugter kleiner als 75°C, am bevorzugtesten kleiner als 50°C, am allerbevorzugtesten bei Raumtemperatur, erfolgt.

- 29 -

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Aufbringung des Schutzschichtmaterials (9,9') mit einem Sol-Gel Verfahren erfolgt.
3. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Schutzschichtmaterial (9,9') nach der Aufbringung auf die Strukturschicht, vorzugsweise bei Raumtemperatur, mit einem Ammoniakgas zur Ausbildung der Schutzschicht (10,10') ausgehärtet wird.
4. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das, vorzugsweise flüssige, Schutzschichtmaterial (9,9') in die Schutzschicht (10, 10') umgewandelt wird, wobei die Schutzschicht (10, 10') glasartig ist.
5. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Strukturschicht (7) Strukturen (5,5') aufweist, wobei die Strukturen (5,5') als optische Systeme ausgebildet sind.